

シンガポールの商標に関する通達（Circular）の公表について

2015年12月8日
ジェトロ・バンコク事務所

シンガポール知財庁（IPOS）は11月30日商標に関する通達（Circular）No. 10/2015を同庁ウェブサイトにおいて公開したⁱ。同通達の概要は以下の通り。

1. 商標規則の改正について

現在の商標規則では商標規則別紙3にニース協定に基づく分類に従った指定区分、指定商品、指定役務が列挙されているが、ニース分類の変更の度に商標規則別紙3を改正することを避けるため、商標規則の第1条に「ニース協定（"Nice Agreement"）」及び「ニース分類（"Nice Classification"）」の定義を設け、「別紙3に従って分類する」としていた第19条を「ニース分類に従って分類する」と変更することとした。この商標規則の改正は2016年1月1日から施行される。

2. 商標ワークマニュアルにおける国際出願に関する新たな章の追加

シンガポール知的財産庁は、商標出願及び審査方法等の詳細を規定したワークマニュアルについて、(i)マドプロ出願においてシンガポールを事後指定する際の手続き及び(ii)シンガポール出願を基礎として国際出願を行う際の手続きに関する2つの章を新設し、それぞれの手続きと実務の詳細を規定した。

3. 商標ワークマニュアルにおける立体商標及び商標登録拒絶の相対的理由に関する章の改正について

シンガポール知的財産庁は、商標出願及び審査方法等の詳細を規定したワークマニュアルについて、既存の立体商標に関する章について、立体商標の審査方法をより明確にするための改正を行った。

また、既存の商標登録の相対的拒絶理由に関する章については、相対的理由を根拠とした拒絶査定に対する、善意の併存使用（"honest concurrent use"）を理由とした不服申立に関する手続きを明確にするための改正を行った。

ⁱ 同庁ウェブサイト該当ページ（英語）

http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIPWhatisIntellectualProperty/Whatisatrademark/CircularsandPracticeDirections/2015.aspx#201510_1

本内容は、日本貿易振興機構が2015年12月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは当該機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことを予めお断りします。